

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年6月5日(05.06.2025)



(10) 国際公開番号

WO 2025/115804 A1

(51) 国際特許分類:
G03F 7/004 (2006.01) C08F 220/12 (2006.01)
C07C 309/80 (2006.01) C09K 3/00 (2006.01)
C07C 381/12 (2006.01) G03F 7/039 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/041628

(22) 国際出願日: 2024年11月25日(25.11.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2023-202572 2023年11月30日(30.11.2023) JP

(71) 出願人: セントラル硝子株式会社
(CENTRAL GLASS COMPANY, LIMITED) [JP/
JP]; 〒7550001 山口県宇部市大字沖宇部
5 2 5 3 番地 (JP).

(72) 発明者: 増 渕 毅 (MASUBUCHI Takashi);
〒1010054 東京都千代田区神田錦町 3 丁目 7 番
地 1 セントラル硝子株式会社内 (JP). 今泉 勇
紀(IMAIZUMI Yuki); 〒1010054 東京都千代田
区神田錦町 3 丁目 7 番地 1 セントラル硝子株
式会社内 (JP). 三浦 雅大(MIURA Masahiro);
〒1010054 東京都千代田区神田錦町 3 丁目 7
番地 1 セントラル硝子株式会社内 (JP). 藤本
雅隆(FUJIMOTO Masataka); 〒1010054 東京都
千代田区神田錦町 3 丁目 7 番地 1 セントラ
ル硝子株式会社内 (JP). 増田 隆司(MASUDA
Takashi); 〒1010054 東京都千代田区神田錦町 3

丁目 7 番地 1 セントラル硝子株式会社内 (JP).
本田 雄暉(HONDA Yuki); 〒1010054 東京都千
代田区神田錦町 3 丁目 7 番地 1 セントラル硝子
株式会社内 (JP). 兼子 譲(KANEKO Yuzuru);
〒1010054 東京都千代田区神田錦町 3 丁目 7 番
地 1 セントラル硝子株式会社内 (JP).

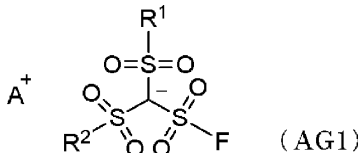
(74) 代理人: 速水 進治(HAYAMI Shinji); 〒1410031
東京都品川区西五反田 7 丁目 9 番 2 号
KDX五反田ビル9階 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC,
EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,
HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG,
KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU,
LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS,
MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,
TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,

(54) Title: RADIATION-SENSITIVE RESIN COMPOSITION, PATTERN FORMATION METHOD, METHOD FOR PRODUCING ELECTRONIC DEVICE, ACID GENERATION AGENT, METHOD FOR PRODUCING COMPOUND, COMPOUND, AND ACID GENERATION METHOD

(54) 発明の名称: 感放射線性樹脂組成物、パターン形成方法、電子デバイスの製造方法、酸発生剤、化合物の製造方法、化合物および酸発生方法



(57) Abstract: Provided is a radiation-sensitive resin composition comprising an acid generation agent represented by general formula (AG1). In general formula (AG1), R¹ and R² each independently represent a fluorine atom or -OR, R is a monovalent organic group, and A⁺ is a counter cation. Also provided is an acid generation agent represented by general formula (AG1). Further provided is a compound represented by general formula (AG1).

(57) 要約: 以下一般式 (AG1) で表される酸発生剤を含む、感放射線性樹脂組成物。一般式 (AG1) 中、R¹ および R² は、それぞれ独立にフッ素原子または -OR であり、R は 1 価の有機基であり、A⁺ は、対カチオンである。また、以下一般式 (AG1) で表される酸発生剤。また、以下一般式 (AG1) で表される化合物。

[続葉有]

WO 2025/115804 A1

IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）